

Montevideo, 26 de octubre de 2018

Circular N° 5/2018

Por Circular 11/2015 se buscó unificar los criterios a aplicar por la Oficina respecto a las diversas concesiones de vistas durante los trámites de solicitud regidos por la ley 17.164

Dado el tiempo transcurrido se procedió a evaluar los resultados de la aplicación de referida circular.

Con base en dicha evaluación, la Dirección dispone que a partir del 1ero de Noviembre de 2018, deberán aplicarse las siguientes directivas por los examinadores:

- a)** Durante el examen de fondo de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad se conferirán como máximo dos vistas, de acuerdo a lo que se establece seguidamente:
 - o Los examinadores de patentes de invención y modelos de utilidad, al conferir vista del informe del fondo, deberán hacerlo por un plazo de 45 días, que será prorrogable por una única vez – mediando petición expresa del solicitante - por un plazo de 45 días adicionales
 - o Si de la evacuación de la vista o en el plazo para contestarla surgieran elementos nuevos o supervinientes, que pudieran afectar la patentabilidad, el examinador podrá conceder una única vista por el plazo de 30 días, prorrogables por una única vez – mediando pedido expreso del solicitante – por otros 30 días adicionales. En estos casos el examinador deberá indicar expresamente cuáles son los elementos nuevos o supervinientes que a su juicio ameritan la concesión de la vista.
- b)** Respecto a las restantes vistas conferidas al amparo del artículo 37 del Decreto 11/000, las prórogas se concederán – mediando petición expresa del solicitante – por 15 días adicionales.

Evacuada la vista del informe de fondo o la vista adicional en su caso el examinador resolverá de acuerdo a las resultancias de obrados.

I) Comuníquese a la Encargada de División Patentes y a los examinadores del área

II) Déjase sin efecto lo dispuesto por Circular 11/2015 a partir del 1ero de noviembre de 2018.

Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese



Dra. Mariana Delor
Directora Nacional
de la Propiedad Industrial